



บทที่ 5

สมบัติเชิงไฟฟ้าของสารกึ่งตัวนำ

ในสารกึ่งตัวนำที่อุณหภูมิห้องอิเล็กตรอนมีโอกาสที่จะกระโดดขึ้นไปยังແเกບนำและโยลไปยังແเกບวาเลนซ์ดังที่กล่าวมาแล้วโดยความหนาแน่นของพานะอิสระที่สภาวะสมดุลเชิงความร้อนและชนิดของพานะอิสระจะเป็นตัวกำหนดสภาพนำไฟฟ้าที่อุณหภูมิใดๆ ของสารกึ่งตัวนำ

บทนี้จะกล่าวถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความหนาแน่นของพานะอิสระ (carrier concentration) ที่สภาวะสมดุลเชิงความร้อน สภาพนำไฟฟ้าและวิธีการวัดสภาพต้านทานไฟฟ้าที่ใช้กันทั่วไปในสารกึ่งตัวนำ

ความหนาแน่นของพานะอิสระที่สภาวะสมดุลเชิงความร้อน [15,16]

สภาพนำไฟฟ้าของสารกึ่งตัวนำเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิ เนื่องจากอิเล็กตรอนในແเกບวาเลนซ์และหรือจากผู้ให้ (Donor) ถูกกระตุ้นด้วยพลังงานความร้อน (Thermal energy) ให้ขึ้นไปยังແเกບนำ และทิ้งที่ว่างไว้ในແเกບวาเลนซ์ เรียกว่า โยล โดยโอกาสที่อิเล็กตรอนจะถูกกระตุ้นด้วยพลังงานความร้อนจะเป็นไปตามฟังก์ชันการแจกแจงพลังงานของเฟอร์นี-ไดแรค (Fermi-Dirac distribution function) ดังนี้

$$f(E) = \frac{1}{\exp\left[\left(\frac{E-E_F}{kT}\right)\right] + 1} \quad (5.1)$$

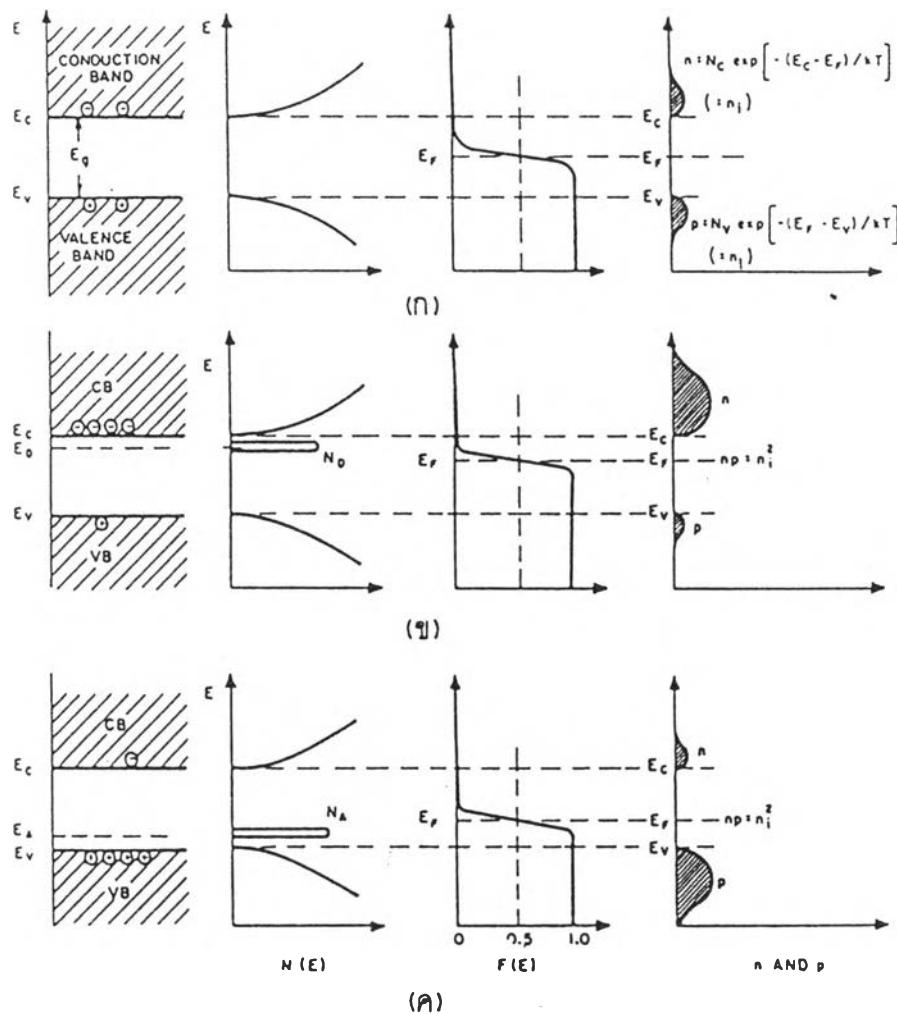
โดย $f(E)$ คือ โอกาสที่จะพบอิเล็กตรอนที่ระดับพลังงาน E เมื่อระบบสมดุลที่อุณหภูมิ T ได้

E_F คือ ระดับพลังงานเฟอร์นี (Fermi energy level)

k คือ ค่าคงที่ของโบลซ์มานน์ (Boltzmann constant)

T คือ อุณหภูมิในหน่วยของเคลวิน (K)

ระดับพลังงานเฟอร์นี (Fermi level) คือ ระดับพลังงานที่กำหนดสภาวะสมดุลความร้อนของระบบโดยขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ และปริมาณของอิเล็กตรอนทั้งหมดในระบบ โดยความหนาแน่นของพานะอิสระที่สภาวะสมดุลเชิงความร้อน สามารถแยกได้เป็นกรณีของสารกึ่งตัวนำที่ไม่ได้เติมสิ่งเจือปน (intrinsic semiconductor) และกรณีที่เติมสิ่งเจือปน (extrinsic semiconductor) ตามลักษณะไดอะแกรมแบบพลังงาน ความหนาแน่นของสถานะ การกระจายของฟังก์ชันเฟอร์นี - ไดเรก และความหนาแน่นพานะอิสระ [15] ดังแสดงในรูปที่ 5.1



รูปที่ 5.1 แสดงไดอะแกรมแบบพลังงาน ความหนาแน่นของสถานะ การกระจายของฟังก์ชันเฟอร์นี-ไดเรก และความหนาแน่นพานะอิสระ ตามลำดับ

- สารกึ่งตัวนำชนิดอินทรินสิก
- สารกึ่งตัวนำชนิดเอ็น
- สารกึ่งตัวนำชนิดพี

1. สารกึ่งตัวนำชนิดอินทรินสิก

สารกึ่งตัวนำชนิดนี้จะเริ่มน้ำไฟฟ้าได้เมื่ออุณหภูมิสูงกว่าศูนย์องศาสัมบูรณ์ เนื่องจาก อิเล็กตรอนในแบบว่าเลนซ์จะถูกกระตุ้นด้วยพลังงานความร้อนให้กระโดดขึ้นไปยังแบบนำ และทิ้ง ตำแหน่งว่างหรือโอลไว้ในแบบว่าเลนซ์ด้วยจำนวนเท่ากัน

หากกำหนดให้ $N_c(E)$ เป็นความหนาแน่นของสถานะของอิเล็กตรอนในแบบนำ ดังนั้น จำนวนสถานะของอิเล็กตรอนต่อหน่วยปริมาตร จากระดับพลังงาน E ถึง $E+dE$ ได้ จะมี ค่าเท่ากับ $N_c(E)dE$ และเนื่องจากในแต่ละสถานะมีโอกาสที่อิเล็กตรอนจะเข้าไปครอบครองเท่ากับ $f(E)$ ดังนั้นจำนวนอิเล็กตรอนต่อหน่วยปริมาตรในช่วงพลังงาน E ถึง $E+dE$ ได้ มีค่าเป็น $f(E) N_c(E)dE$

$$n = N_c(E) f(E) dE \quad (5.2)$$

โดย

$$N_c(E) = \frac{1}{2\pi^2} \left(\frac{2m_e^*}{h^2} \right)^{3/2} (E-E_c)^{1/2} \quad (5.3)$$

เมื่อ m_e^* คือ มวลยังผล (effective mass) ของอิเล็กตรอนในแบบนำ
 h คือ ค่าคงที่ของแพลนค์ (Planck constant)

และความหนาแน่นของอิเล็กตรอนในแบบนำคือ

$$n = \int_{E_c}^{E_t} N_c(E)f(E)dE \quad (5.4)$$

เมื่อ E_c คือ สถานะพลังงานที่ขอบล่างสุดของแบบนำ
 E_t คือ สถานะพลังงานที่ขอบบนสุดของแบบนำ

เพื่อความสะดวกในการคำนวนจะกำหนดให้ระดับพลังงาน $E = 0$ อยู่ที่ขอบบนสุด ของแบบว่าเลนซ์ และให้มีช่องว่างแบบพลังงานเป็น E_g

ในกรณีที่ช่องว่างแบบพลังงานมีค่ามากกว่าพลังงานความร้อนมาก ($E_g >> kT$) หรือ $E_c - E_{F_i} >> kT$ สารกึ่งตัวนำจะอยู่ในสภาวะ non-degenerate ซึ่งเราสามารถประมาณการ

กระบวนการแบบเฟอร์มี-ไดแรก ด้วยแบบแมกซ์เวลล์-บิลซ์มานน์ และขึ้นต่อจากนั้นของการอินทิเกรตจะเปลี่ยนจาก E_i ไปเป็น ∞ ทำให้สมการที่ (5.4) เปลี่ยนเป็น [16]

$$n_i = \int_{E_C}^{\infty} N_C(E)f(E)dE \quad (5.5)$$

แล้วแทนสมการ (5.1) กับ (5.3) ลงในสมการ (5.5) จะได้

$$n_i = \frac{1}{2\pi h^2} \left(\frac{m_e^* kT}{h^2} \right)^{3/2} \int_{E_C}^{\infty} (E - E_C)^{1/2} \exp[-(E - E_{F_i})/kT] dE \quad (5.6)$$

ถ้าพิจารณาระดับพลังงานที่สูงกว่าพลังงานความร้อนมากๆ $(E - E_{F_i})/kT \gg 1$ แล้ว

$$n_i = 2 \left(\frac{m_e^* kT}{2\pi h^2} \right)^{3/2} \exp\left(-\frac{E_C - E_{F_i}}{kT}\right)$$

หรือ

$$n_i = N_C \exp\left(-\frac{E_C - E_{F_i}}{kT}\right) \quad (5.7)$$

เมื่อ $N_C = 2 \left(\frac{m_e^* kT}{2\pi h^2} \right)^{3/2}$

ในทำนองเดียวกัน เราสามารถหาความหนาแน่นของไฮโลในแต่ละว่าเล่นได้ดังสมการ

$$p_i = 2 \left(\frac{m_e^* kT}{2\pi h^2} \right)^{3/2} \exp\left(-\frac{E_{F_i} - E_V}{kT}\right).$$

หรือ

$$p_i = N_V \exp\left(-\frac{E_{F_i} - E_v}{kT}\right) \quad (5.8)$$

เมื่อ $N_V = 2 \left(\frac{m^*_h kT}{2\pi\hbar^2} \right)^{3/2}$

E_v คือ สถานะพลังงานที่ขอบนลุดของแกบวาเลนซ์
 m_h^* คือ มวลยังผล (effective mass) ของไฮดในแกบวาเลนซ์
 และเมื่อนำสมการที่ (5.7) กับ (5.8) คูณกันจะได้

$$n_i^2 = n p_i = N_c N_V \exp(-Eg/kT) \quad (5.9)$$

หรือ

$$n_i = (N_c N_V)^{1/2} \exp(-Eg/2kT) \quad (5.10)$$

เมื่อ Eg คือ ขนาดของช่องว่างแกบพลังงาน = $E_c - E_v$
 สมการ (5.9) นี้เรียกว่า กฎของกริยาเชิงมวล (mass action law) [16] ที่สมดุลความร้อน ซึ่งหมายถึง ผลคูณของความหนาแน่นของพาหะอิสระทั้งสองที่มีค่าคงที่ที่อุณหภูมิใดอุณหภูมินั่นโดยไม่ขึ้นกับระดับพลังงานเฟอร์มี

ในสารกึ่งตัวนำที่เป็นผลึกสมบูรณ์ (Perfect crystal) และไม่มีสิ่งเจือปน ความหนาแน่นของอิเล็กตรอนในแกบนำและความหนาแน่นของไฮดในแกบวาเลนซ์จะเท่ากัน คือ $n_i = p_i$ และ ระดับพลังงานเฟอร์มีจะเป็นไปตามความสัมพันธ์

$$E_{F_i} = \frac{1}{2} Eg + \frac{1}{2} kT \ln\left(\frac{N_V}{N_c}\right) \quad (5.11)$$

หรือ

$$E_{F_i} = \frac{1}{2} Eg + \frac{3}{4} kT \ln\left(\frac{m_h^*}{m_e^*}\right) \quad (5.12)$$

สมการที่ (5.11) และ (5.12) คือ ระดับพลังงานเฟอร์ม (E_F) ของสารกึ่งตัวนำชนิดอินทรินสิก จะอยู่ที่จุดกึ่งกลางของช่องว่างแกบพลังงาน (E_g) และเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิไม่มากนัก [16]

2. สารกึ่งตัวนำชนิดເອັກສ່ວນສີກ

สารกึ่งตัวนำที่มีการเติมสิ่งเจือปนลงไป เช่น อะตอมเจือปน จะก่อให้เกิดระดับพลังงาน ของสิ่งเจือปน (Impurity level) ขึ้นในช่องว่างแกบพลังงาน การเติมสิ่งเจือปนลงในสารกึ่งตัวนำ สามารถทำให้เกิดสารกึ่งตัวนำขึ้นสองชนิดโดยขึ้นอยู่กับชนิดของสิ่งเจือปนนั้น ถ้าสิ่งเจือปนเป็น ชนิดผู้ให้ (donor impurity) เรียก สารกึ่งตัวนำนั้นเป็นชนิดເອັນ (n-type semiconductor) ແຕ່ถ้าสิ่งเจือปนเป็นชนิดผู้รับ (acceptor impurity) เรียก สารกึ่งตัวนำนั้นเป็นชนิดພີ (p-type semiconductor)

หากสิ่งเจือปนที่ปรากฏในสารกึ่งตัวนำมีทั้งชนิดผู้ให้และผู้รับ สารกึ่งตัวนำนี้จะມີນິດ การนำไฟฟ້າ (conductivity type) ແບບໄດ້ ກີ່ຂຶ້ນອູ່ກັບຄວາມໜາແນ່ນຂອງພາະຫຼາດ (Majority carrier concentration) ວ່າເກີດຈາກສิ่งเจือปນชนິດໄດ້ ສາຍເຈືອປນທີ່ເຕີມລົງໄປຈະທໍາໃຫ້ຮະດັບພລັງນາງ ເຟອຣົມຂອງสารກົງຕັວນໆນັ້ນປັບຮະດັບເຂົ້າສູ່ສກາວະສມດຸລເຊີງຄວາມຮ້ອນ ($E_{F_i} \rightarrow E_F$) ຈຶ່ງໃນການ ຄໍານວນຄວາມໜາແນ່ນຂອງພາະອີສະຮ້າທີ່ມີເລັກຕຽນແລະໂຍລໃນສກາວະ non-degenerate ສາມາດ ໃຊ້ວິກາරທ່ານອັນເດີຍກັນກັບสารກົງຕັວນໆນັ້ນໃຫ້ຮົມສີກ ຈະໄດ້ຄວາມໜາແນ່ນຂອງອີເລັກຕຽນໃນ ແກບນໍາເປັນ

$$n = 2 \left(\frac{m_e^* kT}{2\pi\hbar^2} \right)^{3/2} \exp\left(-\frac{E_C - E_F}{kT}\right)$$

หรือ

$$n = N_C \exp\left(-\frac{E_C - E_F}{kT}\right) \quad (5.13)$$

ຄວາມໜາແນ່ນຂອງໂຍລໃນແດບວາເລັນເປັນ

$$p = 2 \left(\frac{m_h^* kT}{2\pi\hbar^2} \right)^{3/2} \exp\left(-\frac{E_F - E_V}{kT}\right)$$

หรือ

$$p = N_V \exp\left(-\frac{E_F - E_V}{kT}\right) \quad (5.14)$$

และกฎของกิริยาเชิงมวล เขียนได้เป็น

$$n^2 = np = N_c N_v \exp(-E_g/kT) \quad (5.15)$$

จากสมการที่ (5.15) พบว่าผลคูณของความหนาแน่นของพาหะอิสระทั้งสองชนิดจะมีค่าคงที่ที่อุณหภูมิใดๆ และไม่ขึ้นกับระดับพลังงานเฟอร์มี ดังในสารกึ่งตัวนำของจริง (real crystal) ที่มีทั้งพาหะข้างมาก (majority carriers) และพาหะข้างน้อย (minority carriers)

ตามเงื่อนไขความเป็นกลางทางไฟฟ้า ประจุลบทั้งหมดที่เกิดจากอิเล็กตรอนและผู้รับที่ถูกไอโอดีน (ionized acceptors) ต้องเท่ากับประจุบวกทั้งหมดที่เกิดจากไฮล์และผู้ให้ที่ถูกไอโอดีน (ionized donors) ดังสมการ [15,16]

$$n + N_A^- = p + N_D^+ \quad (5.16)$$

$$n + (N_A^- - n_a^-) = p + (N_D^+ - n_d^+)$$

$$n + N_A^- + n_a^- = p + N_D^+ + n_d^+ \quad (5.17)$$

- เมื่อ N_A^- คือ ความหนาแน่นของผู้รับที่ถูกไอโอดีน
 n_a^- คือ ความหนาแน่นของผู้รับที่ไม่ถูกไอโอดีน
 N_D^+ คือ ความหนาแน่นของผู้ให้ที่ถูกไอโอดีน
 n_d^+ คือ ความหนาแน่นของผู้ให้ที่ไม่ถูกไอโอดีน

โดยที่

$$n_d^+ = \frac{N_D^+}{1 + \frac{1}{g} \exp[(E_D - E_F)/kT]} \quad (5.18)$$

$$n_a = \frac{N_A}{1 + \frac{1}{g} \exp[(E_F - E_A)/kT]} \quad (5.19)$$

เมื่อ g คือ แฟคเตอร์เดจันเนอเรชีท์สถานะพื้น (ground-state degeneracy factor)

E_D คือ ระดับพลังงานของผู้ให้

E_A คือ ระดับพลังงานของผู้รับ

การพิจารณาโดยอาศัยเงื่อนไขความเป็นกลางทางไฟฟ้าของระบบ สามารถแบ่งได้เป็น กรณีดังนี้

กรณีความหนาแน่นของสิงเจ้อปมีน้อยหรืออุณหภูมิสูง

1) กรณี $(N_D - N_A) \ll N_c$ คือ E_F จะอยู่ระหว่าง E_D และ E_A โดยอยู่ค่อนไปทาง E_F ดังนั้น g จะน้อยกว่า N_D มากจนตัดออกได้และความหนาแน่นของผู้รับจะถูก "ไออุ่น" [16] เป็นดังสมการ

$$n + N_A = p + N_D \quad (5.20)$$

จากสมการที่ (5.13), (5.14) และ (5.15) จะได้

$$n_n = \frac{1}{2} \left[N_D - N_A + \sqrt{(N_D - N_A)^2 + 4n_i^2} \right] \quad (5.21)$$

$$p_n = \frac{n_i^2}{n_n} \quad (5.22)$$

โดยที่ n_i คือ พานะข้างมากของสารกึ่งตัวนำชนิดเงิน

p_n คือ พานะข้างน้อยของสารกึ่งตัวนำชนิดเงิน

2) กรณี $(N_A - N_D) \ll N_c$ คือ E_F จะอยู่ระหว่าง E_A และ E_F โดยอยู่ค่อนไปทาง E_F ซึ่งสามารถทำได้ทวนองเดียวกับ 1) จะได้ว่า



$$p_p = \frac{1}{2} \left[N_A - N_D + \sqrt{(N_A - N_D)^2 + 4n_i^2} \right] \quad (5.23)$$

$$n_p = \frac{n_i^2}{p_p} \quad (5.24)$$

โดยที่ p_p คือ พานะข้างมากของสารกึ่งตัวนำชนิดพี

n_p คือ พานะข้างน้อยของสารกึ่งตัวนำชนิดพี

ในทั้งสองกรณีถ้า $|N_D - N_A| \ll n_i$ แล้วสมการ (5.21) และ (5.23) จะกลายเป็น

$$n_n \approx n_i + \frac{1}{2} (N_D - N_A) \quad (5.25)$$

$$p_p \approx n_i + \frac{1}{2} (N_A - N_D) \quad (5.26)$$

จากสมการ (5.25) และ (5.26) จะเห็นว่าพานะข้างมากจะขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของพานะชนิดอินทรินสิก (intrinsic carrier density) จะชัดเจนมากขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ซึ่งอุณหภูมินี้เรียกว่า ช่วงอินทรินสิก (intrinsic region)

แต่ถ้า $|N_D - N_A| \gg n_i$ สมการ (5.21) และ (5.23) จะกลายเป็น

$$n_n \approx N_D - N_A \quad (5.27)$$

$$p_p \approx N_A - N_D \quad (5.28)$$

ในช่วงนี้เป็นช่วงที่อุณหภูมิไม่สูงมากนัก พานะส่วนใหญ่จะได้มาจากการสิงเคอปันที่ถูกไอออกไซน์มด ทำให้ความหนาแน่นของพานะคงที่ เรียกช่วงนี้ว่า ช่วงเอ็กซ์ทรินสิก (extrinsic region)

กรณีความหนาแน่นของสิ่งเจือปนมากหรืออุณหภูมิต่ำ

1) กรณี $N_D > N_A$ พลังงานเนื่องจากความร้อนไม่สามารถจะไอออกในช่องดูดของสิ่งเจือปนได้หมด ดังนั้น n_d ในสมการ (5.17) จึงตัดทิ้งไม่ได้ แต่ใช้ในแบบวัวเลนซ์ (p) และ n_d มีค่าน้อยมากจึงตัดทิ้งได้ ดังนั้นสมการ (5.17) จะกลายเป็น [16,23]

$$n + N_A + n_d = N_D \quad (5.29)$$

แทนสมการ (5.18) ลงใน (5.29) จะได้

$$n = N_D - N_A - \frac{N_D}{1 + \frac{1}{2} \exp [(E_D - E_F)/kT]}$$

$$n = N_D - N_A - \frac{2N_D}{2 + \exp [(E_D - E_F)/kT]}$$

$$2n + n \exp [(E_D - E_F)/kT] = N_D \exp [(E_D - E_F)/kT] - 2N_A - N_A \exp [(E_D - E_F)/kT]$$

$$\text{ให้ } N_C^I = \frac{1}{2} N_C \exp (-E_d/kT) \quad \text{และ } E_d = E_c - E_b$$

$$2n^2 + n(2N_D + 2N_C^I) - 2(N_D - N_A)N_C^I = 0$$

$$n^2 + (N_A + N_C^I)n - (N_D - N_A)N_C^I = 0 \quad (5.30)$$

ดังนั้นเราจะได้

$$n = -\frac{(N_A + N_C^I)}{2} + \frac{1}{2} \left[(N_A + N_C^I)^2 + 4(N_D - N_A)N_C^I \right]^{1/2} \quad (5.31)$$

ที่อุณหภูมิต่ำๆ $E_d >> kT$ และ N_C^I จะมีค่าน้อยมาก ดังนั้นจากสมการ (5.31) เรากระจายเทอมที่ 2 ด้านขวาเมื่อด้วยอนุกรมไบโนเมียล (binomial series) จะได้ [23]

$$\begin{aligned} \left[(N_A + N_C^I)^2 + 4(N_D - N_A)N_C^I \right]^{1/2} &= (N_A + N_C^I) \left[1 + \frac{\frac{4N_C^I(N_D - N_A)}{(N_A + N_C^I)}}{1} \right]^{1/2} \\ &= (N_A + N_C^I) \left[1 + \frac{\frac{2N_C^I(N_D - N_A)}{(N_A + N_C^I)^2}}{1} + \dots \right] \\ &= (N_A + N_C^I) + \frac{\frac{2N_C^I(N_D - N_A)}{(N_A + N_C^I)^2}}{1} + \dots \end{aligned} \quad (5.32)$$

แทนสมการ (5.32) ลงใน (5.31) จะได้

$$n = \frac{\frac{N_C^I(N_D - N_A)}{(N_A + N_C^I)^2}}{1} \quad (5.33)$$

ถ้า $N_A >> N_C^I$ สมการที่ (5.33) จะกล้ายเป็น

$$n = \frac{\frac{N_C^I(N_D - N_A)}{N_A}}{\frac{1}{2N_A}} = \frac{(N_D - N_A)}{2N_A} N_C \exp(-E_d/kT) \quad (5.34)$$

แต่ถ้า N_A มีค่าน้อยมากๆ นั่นคือ $N_D >> N_C^I >> N_A$ จากสมการ (5.30) นำ N_D หารตลอดจะได้

$$\frac{n_i^2}{N_D} \cdot N_C^I = 0$$

$$n^2 = N_C N_D = \frac{1}{2} N_D N_C \exp(-E_d/kT)$$

$$n = \frac{1}{\sqrt{2}} (N_D N_C)^{1/2} \exp(-E_d/2kT) \quad (5.35)$$

ดังนั้นในช่วงอุณหภูมิต่ำๆ ความหนาแน่นของพาหะอิสระ (n) จะขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของสิ่งเดิมชนิดผู้ให้ที่ถูกไอออกไนซ์ ซึ่งจะเป็นไปตามสมการที่ (5.34) หรือ (5.35) ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขคอมเพนเซชัน (compensation) [16] ช่วงนี้เรียกว่า ช่วงฟรีซเอาท์ (freeze-out region)

2) กรณี $N_A > N_D$ คิดทำนองเดียวกับ 1) สมการ (5.17) จะกลายเป็น

$$p + n_s = N_A - N_D \quad (5.36)$$

แทนสมการ (5.19) ลงใน (5.36) จะได้

$$p = \frac{\frac{1}{2}(N_A - N_D)}{N_D + N_V} \quad (5.37)$$

$$\text{โดย } N_V = \frac{1}{2} N_V \exp(-E_a/kT)$$

$$E_a = E_A - E_V$$

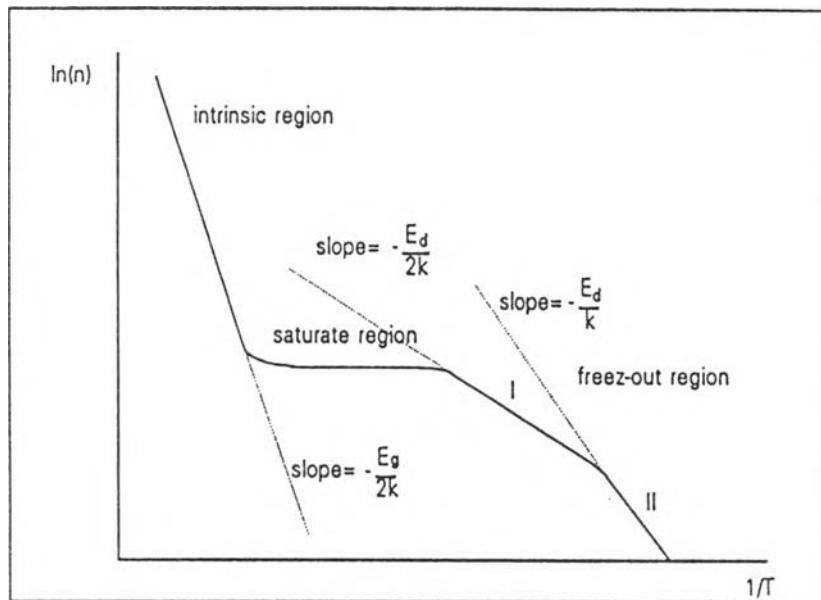
ถ้า $N_D \gg N_V$ สมการ (5.37) จะกลายเป็น

$$p = \frac{(N_A - N_D)}{2N_D} N_V \exp(-E_a/kT) \quad (5.38)$$

แต่ถ้า N_D มีค่าน้อยมากๆ คือ $N_A \gg N_D \gg N_V$ จะได้ว่า

$$p = \frac{1}{\sqrt{2}} (N_A N_V)^{1/2} \exp(-E_a/2kT) \quad (5.39)$$

ในรูปที่ 5.2 กราฟช่วงอุณหภูมิต่างๆ พบร่วมกันแน่นของอิเล็กตรอนในแบบนี้ จะน้อยกว่าความหนาแน่นของสิ่งเจือปนชนิดผู้ให้ (N_D) เนื่องจากโอกาสที่อิเล็กตรอนจะถูกไอออกในช่วงพลังงานความร้อน (kT) มีค่าน้อยและความหนาแน่นของอิเล็กตรอนในแบบนี้จะเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิ ซึ่งนี้เรียกว่า ช่วงฟรีซเอาท์ (freeze-out region) สำหรับช่วงอุณหภูมิปานกลางความหนาแน่นของอิเล็กตรอนได้มาจากอะตอมของสิ่งเจือปนที่ถูกไอออกในช่วงหนด ($n = N_D$) เรียกช่วงนี้ว่า ช่วงเอ็กซ์ทรินสิก (extrinsic region) และในช่วงอุณหภูมิสูงๆ อิเล็กตรอนส่วนใหญ่เป็นของสารกึ่งตัวนำชนิดอินทรินสิกโดย เพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิ เรียกช่วงนี้ว่า ช่วงอินทรินสิก (intrinsic region)



รูปที่ 5.2 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นของอิเล็กตรอนกับส่วนกลับของอุณหภูมิ

สภาพนำไฟฟ้าเนื่องจากอิเล็กตรอนและไฮด์รอน

การใช้สนามไฟฟ้าเข้าไปในสารกึ่งตัวนำ จะทำให้อิเล็กตรอนที่อยู่ในแบบนำตอบสนองต่อสนามไฟฟ้านี้ โดยอิเล็กตรอนเกิดการเคลื่อนที่กลับเป็นกระแสไฟฟ้า จากกฎของโอม (Ohm's law) สภาพนำไฟฟ้า (σ) คือ อัตราส่วนของความหนาแน่นกระแสไฟฟ้า (Current density, J) ต่อ สนามไฟฟ้า (Electric field, E) ที่ใส่เข้าไป [19] ดังสมการ

$$\sigma = J/E \quad (5.40)$$

$$\text{โดยที่ } J = nev \quad (5.41)$$

n คือ จำนวนอิเล็กตรอน

e คือ ประจุของอิเล็กตรอน

v คือ ความเร็วของอิเล็กตรอน (Drift velocity) ของอิเล็กตรอน

ดังนั้นสภาพนำไฟฟ้าของสารกึ่งตัวนำเนื่องจากอิเล็กตรอนในแบบนำคือ

$$\sigma = nq\mu_n \quad (5.42)$$

เมื่อ $\mu_n = v/E$ เรียกว่า สภาพเคลื่อนที่ได้ (Mobility) ของอิเล็กตรอน [19]

สภาพนำไฟฟ้าเนื่องจากไฮด์รอนในแบบนำคือ

$$\sigma = pq\mu_p \quad (5.43)$$

เมื่อ μ_p เรียกว่า สภาพเคลื่อนที่ได้ (Mobility) ของไฮด์รอน

ดังนั้นสภาพนำไฟฟ้าของสารกึ่งตัวนำขึ้นเนื่องมาจากอิเล็กตรอนและไฮด์รอนคือ

$$\sigma = nq\mu_n + pq\mu_p \quad (5.44)$$

ในกรณีที่เป็นสารกึ่งตัวนำชนิดอินทรินสิกสภาพนำไฟฟ้าจะเป็นไปตามสมการ

$$\sigma = (N_c N_v)^{1/2} q (\mu_n + \mu_p) \exp(-Eg/2kT) \quad (5.45)$$

$$\ln \sigma = \ln [(N_c N_v)^{1/2} q (\mu_n + \mu_p)] - (Eg/2kT) \quad (5.46)$$

หรือ

จากสมการที่(5.46) สภาพนำไฟฟ้าของสารกึ่งตัวนำชนิดอินทริสิกจะเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิซึ่งเป็นสมบัติของสารกึ่งตัวนำโดยเฉพาะ เมื่อเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง $\ln \sigma$ กับ $1/T$ จะได้เส้นตรงที่มีความชัน (slope) เท่ากับ $-Eg/2k$ ดังนั้นจึงหาค่าซึ่งว่างແเกบพลังงานได้กรณีสารกึ่งตัวนำชนิดເອັນພາະຂ້າງມາກจะເປັນອີເລິກຕອນໃນແກບນໍາ ดังนั้นสภาพนำไฟฟ้าโดยประมาณคือ

$$\sigma \approx nq\mu_n \quad (5.47)$$

แทนค่าความหนาแน่นของອີເລິກຕອນໃນແກບນໍາ (n) จากสมการที่ (5.34) และ(5.35) ลงในสมการที่ (5.47) จะได้สภาพนำไฟฟ้าเมื่อมີອີເລິກຕອນເປັນພາະຂ້າງມາກທີ່ອຸນຫຼາມມີຕໍ່ເປັນ

$$\sigma \approx q\mu_n \frac{\left(\frac{N_D - N_A}{2N_A}\right)}{N_C} \exp(-Ed/kT) \quad (5.48)$$

$$\sigma \approx q\mu_n \left(\frac{\frac{N_D N_C}{2}}{2}\right)^{1/2} \exp(-Ed/2kT) \quad (5.49)$$

เมื่อเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง $\ln \sigma$ กับ $1/T$ จะได้กราฟเส้นตรงที่มีความชันเท่ากับ $-Ed/k$ หรือ $-Ed/2k$ ทำให้สามารถถูくるຳພັດງານໄອອີໃນຮົງຮະດັບພັດງານສິ່ງເຈືອປັນໄດ້ សວນกรณีสารกึ่งตัวนำชนิดພຶພາະຂ້າງມາກຈະເປັນໂຍລໃນແກບວາເລັນ໌ ดังนั้นสภาพนำไฟฟ้าโดยประมาณคือ

$$\sigma \approx nq\mu_p \quad (5.50)$$

แทนค่าความหนาแน่นของໂຍລໃນແກບວາເລັນ໌ (p) จากสมการที่ (5.38) และ (5.39) ลงในสมการที่ (5.50) จะได้สภาพนำไฟฟ้าเมื่ມີໂຍລເປັນພາະຂ້າງມາກທີ່ອຸນຫຼາມມີຕໍ່ເປັນ

$$\sigma \approx q\mu_p \left(\frac{\frac{N_A - N_D}{2N_D}}{N_V}\right) N_V \exp(-Ea/kT) \quad (5.51)$$

$$\sigma \approx q\mu_p \left(\frac{\frac{N_V N_A}{2}}{2}\right)^{1/2} \exp(-Ea/2kT) \quad (5.52)$$

เมื่อเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง I_{kT} กับ $1/T$ จะได้กราฟเส้นตรงที่มีความชันเท่ากับ $-E_a/k$ หรือ $-E_a/2k$ ทำให้สามารถรู้ค่าพลังงานไอօนของระดับพลังงานสิงเจือปนได้เช่นเดียวกัน

การวัดสภาพต้านทานไฟฟ้า [17,18]

การวัดสภาพต้านทานไฟฟ้าของสารกึ่งตัวนำสามารถวัดได้หลายวิธีคือวิธีที่ใช้ส่วนของอุปกรณ์สัมผัสกับชิ้นสารตัวอย่าง และวิธีที่ไม่สัมผัสโดยตรง แต่ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงวิธีที่ใช้การสัมผัสโดยผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในชิ้นสารตัวอย่างแล้ววัดความต่างศักย์แรงดึงดูดสองจุดบนชิ้นสารตัวอย่างนั้น ซึ่งจัดว่าเป็นวิธีมาตรฐานที่ใช้กันทั่วไป โดยขึ้นอยู่กับชนิด ขนาดและรูปร่างของสารตัวอย่าง จำแนกเป็นวิธีต่างๆ ได้ดังนี้

1. วิธีวัดโดยตรง (Direct method)

วิธีนี้ใช้วัดสารตัวอย่างรูปทรงกระบวนการโดยต้องทราบขนาดที่แน่นอน เมื่อวัดค่าความต้านทาน (R) และจึงคำนวนค่าสภาพต้านทานไฟฟ้า (ρ) ได้จาก

$$\rho = \frac{RA}{L} \quad (5.53)$$

โดยที่ A คือ พื้นที่หน้าตัดของสารตัวอย่าง

L คือ ความยาวของสารตัวอย่าง

ค่าสภาพต้านทานที่วัดด้วยวิธีนี้จะรวมเอาค่าความต้านทานของรอยต่อ (Contact resistance) ระหว่างสารกึ่งตัวนำกับขั้วสัมผัส (Probe) ที่ใช้นั้นเข้าไปด้วยเราสามารถลดผลของการต้านทานที่รอยต่อได้ โดยเขียนกราฟระหว่างค่าสภาพต้านทานไฟฟ้ากับความต่างศักย์ไฟฟ้า ซึ่งจากกราฟค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าค่อยๆ ลดลงจนกระทั่งคงที่เมื่อเพิ่มความต่างศักย์ไฟฟ้าค่าคงที่นี้คือค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าที่แท้จริงของสารกึ่งตัวนำ

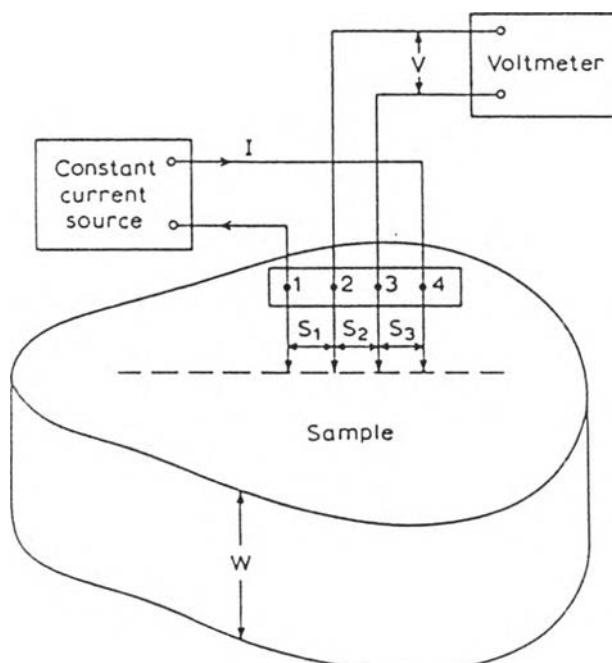
2. วิธีวัดด้วยข้าป้ายแหลมสองข้าง (The Two Point Probe method)

วิธีนี้จะใช้ปืนห่าเรื่องความต้านทานที่ร้อยต่อออกไปได้ถ้าพื้นที่หน้าตัดของสารกึ่งตัวนำที่ใช้วัดมีขนาดคงที่และกระแสไฟฟ้าที่ใช้ต้องมีค่าไม่สูงเกินไป เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงของสภาพต้านทานไฟฟ้าจากความร้อน และโลลด์มิเตอร์ต้องมีค่าออมพิడเอนซ์สูง (High impedance) การวัดจะกระทำโดยการวางข้าป้ายสองข้างของโลลด์มิเตอร์ไปบนแท่งสารกึ่งตัวนำที่ตัดแน่นต่างๆ โดยให้ห่างจากการอยู่ของโลหะที่ใช้ทำข้าป้ายไฟฟ้าพอสมควร เพื่อลีกเลี้ยงการบิดเบี้ยว (Distorted) ของเส้นสมศักย์ (Equipotential lines) ที่บริเวณปลายทั้งสองข้างของแท่งสารกึ่งตัวนำ

3. วิธีวัดด้วยข้าป้ายแหลมสี่ข้างตามแนวเส้นตรง

(Linear Four-Point Probe method)

วิธีนี้จะไม่ก่อให้เกิดการเสียหายกับชิ้นสารกึ่งตัวนำที่นำมาวัด โดยใช้ข้าป้ายสี่ข้างเรียงกันในแนวเส้นตรงเดียวกัน ให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านข้าป้ายสี่คู่นอก ส่วนคู่ส้มผัสคู่ในทำหน้าที่วัดความต่างศักย์ที่เกิดขึ้น ดังรูปที่ 5.3



รูปที่ 5.3 แสดงตำแหน่งของข้าป้ายตามวิธีวัดด้วยข้าป้ายแหลมสี่ข้างในแนวเส้นตรง

ถ้าหากคิดว่าสารตัวอย่างเป็นแบบ semi-infinite (Semi-infinite) จะได้ค่าสกัดต้านทานไฟฟ้าเป็น

$$\rho = \frac{2\pi(V/I)}{[1/s_1 + 1/s_3 - 1/(s_1+s_2) - 1/(s_2+s_3)]} \quad (5.54)$$

เมื่อ V คือ ความต่างศักย์ไฟฟ้า

I คือ กระแสไฟฟ้า

ถ้าจะหานะห่วงระหว่างขั้วสัมผัสมีค่าเท่ากัน ($s_1 = s_2 = s_3 = s$) สมการที่ (5.54) จะกลับเป็น

$$\rho = 2\pi s \frac{V}{I} \quad (5.55)$$

นอกจากจะใช้กับสารตัวอย่างที่เป็นแผ่นบาง (Sheet) โดยที่มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมหรือวงกลมได้แล้ว ยังใช้ได้กับสารตัวอย่างที่มีรูปร่างเป็นทรงกระบอกตันหรือครึ่งทรงกระบอกได้อีกด้วย

4. วิธีวัดด้วยขั้วสัมผัสที่ไม่อยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน

(Non-colinear Probe Spacing method)

การจัดวางตำแหน่งของขั้วสัมผัสที่ไม่อยู่ในแนวเดียวกัน แต่เป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบต่างๆ ตามลักษณะขั้วสารตัวอย่างหรือตามความเหมาะสมที่ผู้วัดเห็นสมควรมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส (Square Array)

วิธีนี้มีการหาเฟคเตอร์ค่าแก้ที่เหมาะสม เพื่อใช้กับสารตัวอย่างที่เป็นแผ่นบางรูปร่างต่างๆ ได้ มีสมการพื้นฐานที่ใช้ในการคำนวณคือ

$$\rho = \frac{2\pi s \frac{V}{I}}{(2-\sqrt{2})^2} \quad (5.56)$$

รูปสี่เหลี่ยมคงที่ (Delta Four-Point Probe)

เป็นวิธีทางสภาพต้านทานไฟฟ้าของสารกึ่งตัวนำที่เป็นชั้นบางๆ (Thin layer) ซึ่งมีค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าสูงกว่าแผ่นรองรับ (Substrate) ช่วงของสภาพต้านทานที่วัดได้จะขึ้นอยู่กับความหนาของชั้นบางๆ กับระยะห่างระหว่างขั้วสมผัส และความหนา กับค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าของแผ่นรองรับ

ขั้วสมผัสสองด้านบน - ด้านล่าง (Over-Under Probe)

วิธีการวางแผนของขั้วสมผัสระหว่างคู่ที่ให้กระแสไฟฟ้ากับคู่ที่วัดความต่างศักย์ไฟฟ้าจะอยู่คนละด้านของสารกึ่งตัวนำที่เป็นชั้นบางๆ

วิธีวนเดอเพว (Van der Pauw method)

วิธีนี้ใช้กับสารตัวอย่างที่เป็นแผ่นบางรูปร่างไม่แน่นอน มีความหนาสม่ำเสมอ โดยการวางแผนของขั้วสมผัสนี้อยู่ที่ขอบของชิ้นสารตัวอย่าง ดังจะกล่าวถึงรายละเอียดในหัวข้อต่อไป

Description	Geometry	Resistivity given by	Advantages
Square array		$\rho = \frac{2\pi s}{2 - \sqrt{2}} \frac{V}{I}$ $= 10.7 s \frac{V}{I}$	Given probe spacing will fit in smaller area
Square array		$R_s = \frac{2\pi}{\ln 2} \frac{V}{I}$ $= 9.06 \frac{V}{I}$	Given probe spacing will fit in smaller area
Rectangular		$\rho = \frac{2\pi s}{2 - (2/\sqrt{1 + \pi^2})} \frac{V}{I}$	
Random placement at periphery of uniform-thickness plate		See van der Pauw	Irregularly shaped samples can be measured without precalculated correction factors
Delta		See Delta	Can be used to measure thin high-resistivity layers on low-resistivity layers
Over-under		See Over-under	Can be used to measure thin high-resistivity layers on low-resistivity layers

ตารางที่ 5.1 แสดงรายละเอียดในการวัดสภาพต้านทานไฟฟ้าด้วย

วิธีขั้วสมผัสที่ไม่อยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน [17]

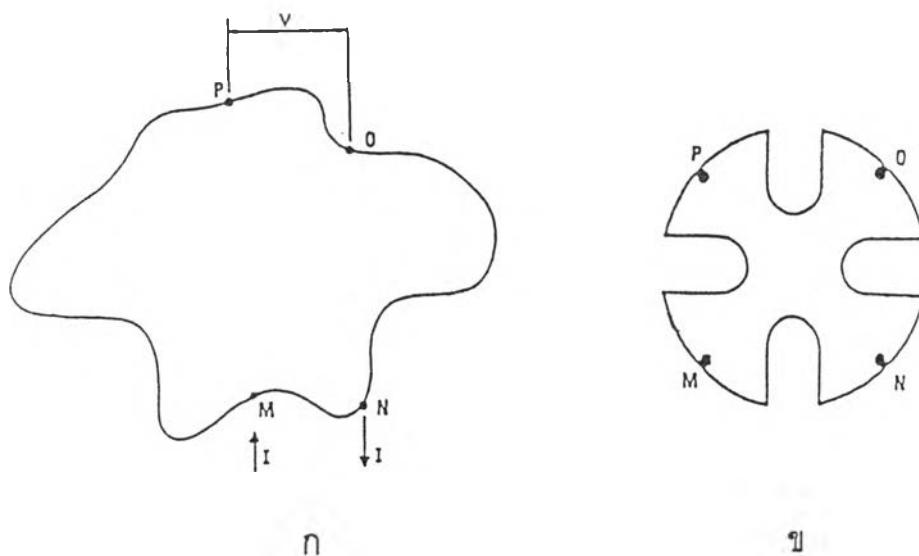


5. การวัดสภาพด้านท่านไฟฟ้าโดยวิธีแวนเดอเพาร์ [17]

ในการวัดสภาพด้านท่านไฟฟ้าด้วยวิธีของแวนเดอเพาร์นี้ จะให้ค่าถูกต้องแม่นยำต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. ขั้วสมผัสจะต้องอยู่ที่ขอบของสารกึ่งตัวนำ
2. จุดสมผัสต้องมีขนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับขนาดของเส้นรอบรูปของสารตัวอย่าง
3. สารตัวอย่างต้องมีความหนาเทา กันตลอด
4. เนื้อสารจะต้องสม่ำเสมอไม่มีรูหรือรอยแยกใดๆ

เมื่อเพิ่มความยาวของเส้นรอบรูปของสารตัวอย่าง จะช่วยลดความคลาดเคลื่อนของการวัดได้ ดังรูปที่ 5.4



รูปที่ 5.4 ก. แสดงตำแหน่งของจุดสมผัสบนชิ้นสารตัวอย่าง
ข. การเพิ่มความยาวของเส้นรอบรูป

จากรูปที่ 5.4 ถ้าให้กระแสไฟฟ้า I_{MN} ผ่านเข้าทางจุด M ออกทางจุด N เราสามารถวัดความต่างศักย์ $V_{PO} = V_p - V_o$ ซึ่งจะหาค่าความด้านท่านไฟฟ้า (R) ของสารตัวอย่างได้ดังสมการ

$$R_{MN,PO} = \frac{(V_p - V_o)}{I_{MN}} \quad (5.57)$$

ถ้าเปลี่ยนให้กราฟไฟฟ้าเข้าทางจุด N ออกทางจุด O ก็จะได้ความสัมพันธ์เช่นเดียวกับสมการที่ (5.57) คือ

$$R_{NO,PM} = \frac{(v_M - v_P)}{I_{NO}} \quad (5.58)$$

เราสามารถหาค่าสภาพต้านทานไฟฟ้า (ρ) ได้จากสมการ (5.57) และ (5.58) ตามความสัมพันธ์ดังนี้คือ

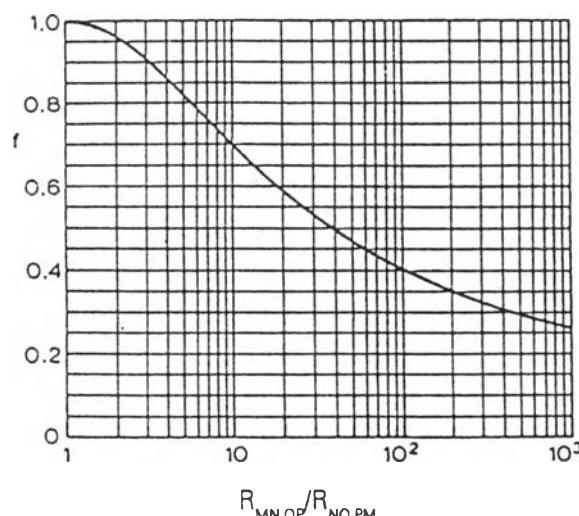
$$\exp(-\frac{\pi d}{\rho} R_{MN,OP}) + \exp(-\frac{\pi d}{\rho} R_{NO,PM}) = 1 \quad (5.59)$$

$$\rho = \frac{\pi d}{\ln 2} \frac{(R_{MN,OP} + R_{NO,PM})}{2} f\left(\frac{R_{MN,OP}}{R_{NO,PM}}\right) \quad (5.60)$$

โดยที่ d คือความหนาของชิ้นสารตัวอย่าง

f เป็นพังก์ชันของ $(R_{MN,OP} / R_{NO,PM})$ เรียกว่า แฟคเตอร์ค่าแก้ (Correcting factor) ดังปรากฏในรูปที่ 5.5

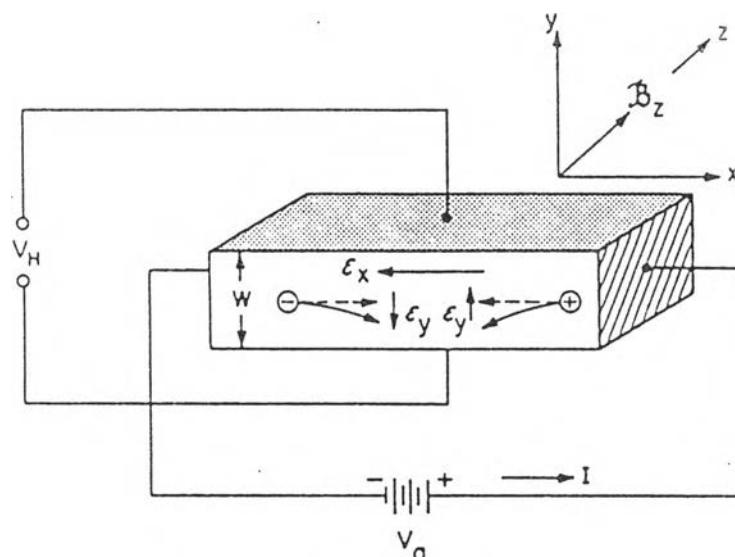
จากสมการที่ (5.60) สามารถหาค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าของสารกึ่งตัวนำรูปร่างใดๆ ที่มีความหนาสม่ำเสมอได้



รูปที่ 5.5 แสดงแฟคเตอร์ค่าแก้ของการวัดสภาพต้านทานไฟฟ้าด้วยวิธีแวนเดอเพาร์ [18]

ปรากฏการณ์ฮอลล์ [19]

ความหนาแน่นของพาหะและสภาพเคลื่อนที่ได้ของฮอลล์ (Hall mobility) จัดเป็นปริมาณพื้นฐานในการกำหนดสมบัติของสารกึ่งตัวนำ สามารถวัดได้โดยอาศัยปรากฏการณ์ฮอลล์ ดังแสดงในรูปที่ 5.6 เริ่มจากการใส่สนามไฟฟ้า E_x ในแนวแกน x , มีกระแสไฟฟ้า (current density , J_x) ไหลในแนวแกน x และมีสนามแม่เหล็กความเข้ม B_z ในแนวแกน z



รูปที่ 5.6 แสดงการวัดความหนาแน่นของพาหะ โดยอาศัยปรากฏการณ์ฮอลล์ [19]

ถ้าพิจารณาในกรณีสารตัวอย่างมีชนิดการนำไฟฟ้าเป็นพิ แรง洛เเรนซ์ที่เกิดขึ้นจะเท่ากับ $qv_x \times B_z$ มีทิศในแนวแกน -y กระทำบนไฮล์ แล้วทำให้ไฮล์ลงมากองอยู่ข้างล่าง ผลให้เกิดสนามไฟฟ้า E_y มีทิศในแนวแกน +y เมื่อสมดุลจะไม่มีกระแสไฟฟ้าในแนวแกน y คือสนามไฟฟ้า E_y จะสมดุลกับแรง洛เเรนซ์ $qv_x \times B_z$ ดังสมการ

$$F_y = qE_y - qv_x \times B_z = 0 \quad (5.61)$$

จะได้ว่า

$$E_y = v_x B_z \quad (5.62)$$

เราเรียก ปรากฏการณ์ของสนามไฟฟ้าที่เกิดในมีนในแนวแกน y ตั้งจากกันทิศของกระแสไฟฟ้าที่ในลในแนวแกน x และทิศของสนามแม่เหล็กในแนวแกน z ว่า ปรากฏการณ์ชอล์ (Hall effect) และเรียก สนามไฟฟ้าที่ถูกซักขึ้นในแนวแกน y ว่า สนามชอล์ (Hall field)
สนามชอล์สามารถตรวจได้จากภายนอกดังนี้

$$\mathcal{E}_y = (v_y/W) = R_H J_x B_z \quad (5.63)$$

โดย

$$J_x = \sigma \mathcal{E}_x$$

R_H คือ สัมประสิทธิ์ของชอล์ (Hall coefficient)

W คือ ความกว้างของสารตัวอย่างในแนวแกน y

$$R_H = \frac{r}{q} \frac{p - b^2 n}{(p + bn)^2} \quad (5.64)$$

$$\text{เมื่อ } b = \mu_n / \mu_p$$

$$r = \langle \tau^2 \rangle / \langle \tau \rangle^2 \quad (5.65)$$

τ คือ เวลาปลดการชนเฉลี่ยระหว่างพำนะ (mean free time) จะขึ้นอยู่กับพลังงานของพำนะ

$$\tau = a E^{-s} \quad (5.66)$$

$$\text{เมื่อ } a \text{ และ } s \text{ คือ ค่าคงที่}$$

ในกรณีพำนะมีพลังงานเท่ากันแบบผิวทรงกลม (spherical constant energy surface)

$$\tau \sim E^{-1/2} \quad \text{สำหรับ phonon scattering}$$

$$\tau \sim E^{3/2} \quad \text{สำหรับ ionized impurity scattering}$$

สำหรับในสารกึ่งตัวนำชนิดไม่เดจูเนอเรชี (non-degeneracy semiconductors)

$$\langle \tau^m \rangle = \int_0^\infty \tau^m E^{3/2} \exp(-E/kT) dE / \int_0^\infty E^{3/2} \exp(-E/kT) dE \quad (5.67)$$

ดังนั้นจากสมการ (5.66) และ (5.67) จะได้ว่า

$$\langle \tau^2 \rangle = a^2 (kT)^{-2s} \Gamma\left(\frac{5}{2} - 2s\right) / \Gamma\left(\frac{5}{2}\right)$$

$$\langle \tau \rangle^2 = [a(kT)^{-s} \Gamma\left(\frac{5}{2} - s\right) / \Gamma\left(\frac{5}{2}\right)]^2 \quad (5.68)$$

โดยที่

$$\Gamma(n) = \int_0^\infty x^{n-1} e^{-x} dx, \quad \Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$$

ดังนั้น $r = \langle \tau^2 \rangle / \langle \tau \rangle^2 = 3\pi/8 = 1.18$ สำหรับ phonon scattering

$r = 315\pi/512 = 1.93$ สำหรับ ionized impurity scattering

สภาพเคลื่อนที่ได้ของชอล์ฟ (μ_h) สามารถนิยามได้ดังนี้

$$\mu_h = |R_h \sigma| \quad (5.69)$$

จะได้ว่า

$$\text{กรณี n-type } (n \gg p) \quad R_h = r(-1/ne) \quad (5.70)$$

$$\text{กรณี p-type } (p \gg n) \quad R_h = r(1/pe) \quad (5.71)$$

จากสมการ (5.70) และ (5.71) พบร่วมปริมาณความเข้มข้นและชนิดของพานะนั้นสามารถหาได้โดยตรงจากการวัดในระบบชอล์ฟ